

最先端リソグラフィプロセス用5 nmフィルター

ウルチプリーツ・P-ナイロン

■ 欠陥レベルの低減

- 厚みのある膜構造 → コンタクトタイム増加とソフトゲル除去率向上
- 金ナノ粒子によるフィルターろ過精度設定 → 微細ナノレベル・コンタミ除去

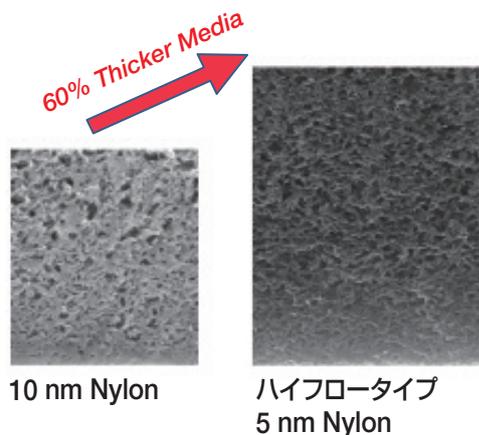
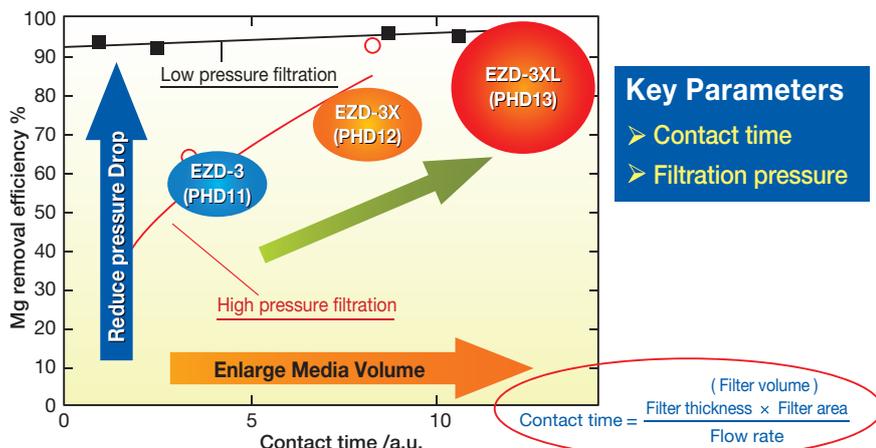
■ フィルター寿命の延長

- ハイフロータイプ膜 → 初期圧力損失の低減

■ フィルター立ち上げ時間短縮と廃棄薬液の低減

- Xpress(特殊洗浄)処理 → フィルター初期清浄度を改善

ナイロン膜の吸着性能の向上



Mg removal efficiency against contact time at different filtration pressures with Mg²⁺-spiked ArF resist polymer solution:

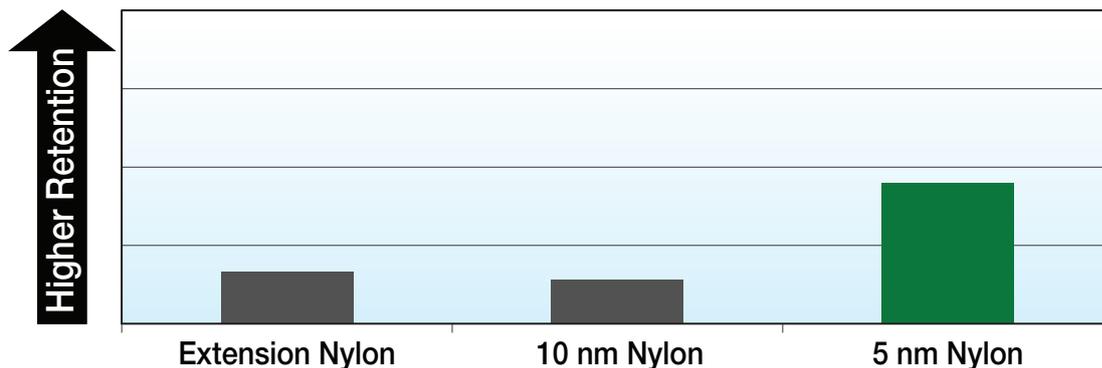
■ Filtration pressure <50kPa; ○ Filtration pressure 200kPa.

Reference :

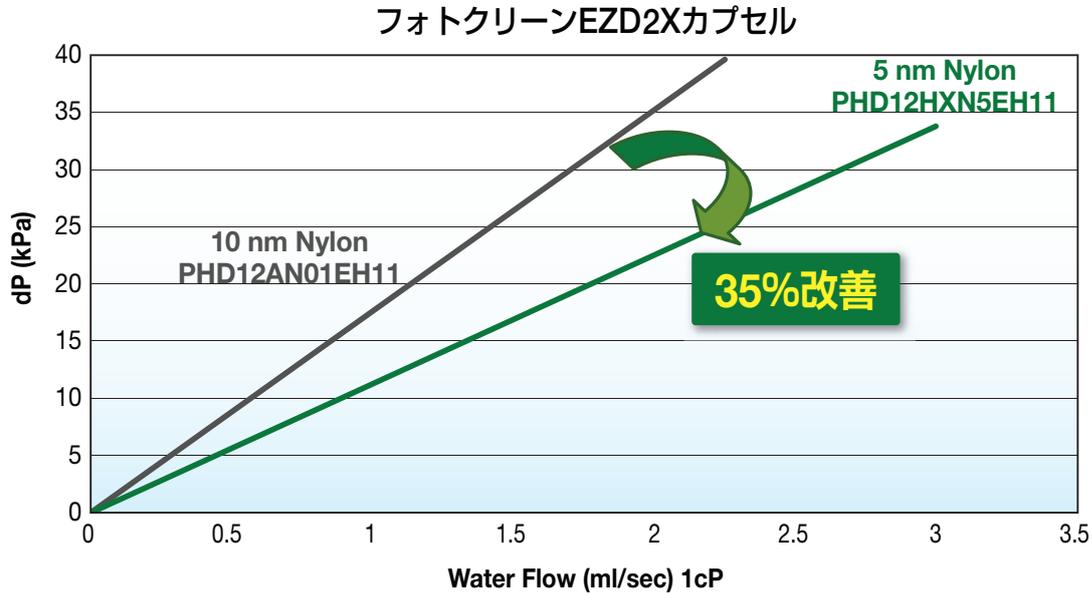
"Filtration condition study for enhanced microbridge reduction" at SPIE Advanced Lithography Asia 2009.

ろ過精度の改善

5 nm Gold Nano-Particle (GNP)

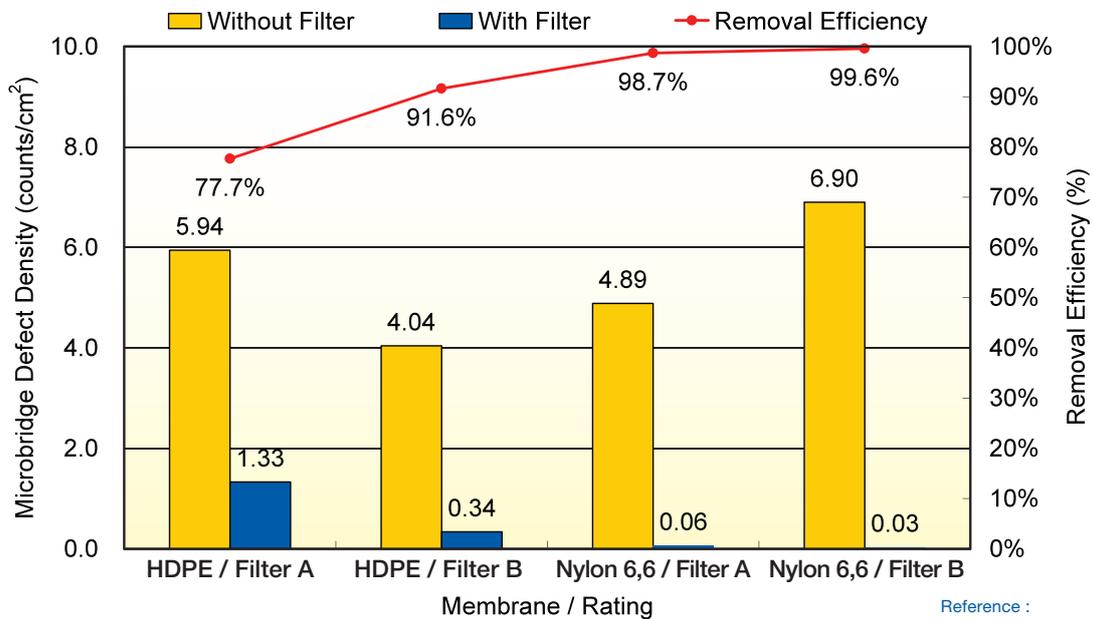


初期圧力損失の低減



ウェハー上の欠陥低減

ブリッジ欠陥の低減



Reference :
"Defect Reduction by using Point-of-use
Filtration in a New Coater/Developer"
at SPIE Advanced Lithography 2009.

お問い合わせ

詳しい内容につきましてご質問がありましたら、下記までお問い合わせください。

【マイクロエレクトロニクス事業部】 TEL.03-6901-5700